

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】令和 7 年 4 月 15 日(2025.4.15)

【国際公開番号】WO2023/013703
 【出願番号】特願 2023-540399(P2023-540399)

【国際特許分類】

H 1 0 N 1 5 / 2 0 (2 0 2 3 . 0 1)

C 2 3 C 1 4 / 0 0 (2 0 0 6 . 0 1)

C 2 3 C 1 4 / 3 4 (2 0 0 6 . 0 1)

H 0 2 N 1 1 / 0 0 (2 0 0 6 . 0 1)

10

【 F I 】

H 1 0 N 1 5 / 2 0

C 2 3 C 1 4 / 0 0 D

C 2 3 C 1 4 / 3 4

H 0 2 N 1 1 / 0 0 A

【手続補正書】

【提出日】令和 7 年 4 月 7 日(2025.4.7)

【手続補正 1】

20

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0047

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0047】

磁性体 21 の前駆体の薄膜をスパッタリングによって形成するとき、ターゲット材と基材 10 との間の距離である TS 距離は、磁性体 21 における比 D/D_0 が 0.80 以上である限り、特定の値に限定されない。TS 距離は、例えば 120 mm 以下である。この場合、基材 10 が有機ポリマー等の有機材料を含む場合でも、磁性体 21 の密度が高くなりやすく、比 D/D_0 が 0.80 以上になりやすい。TS 距離は、望ましくは 100 mm 以下であり、より望ましくは 80 mm 以下であり、さらに望ましくは 60 mm 以下である。TS 距離は、例えば 40 mm 以上である。この場合、ターゲットが磁性体である場合でも、放電が起こりやすく、薄膜を安定的に形成できる。

30

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0072

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0072】

表 2 に示す通り、実施例 1、4~6、並びに比較例 2 及び 3 において、密着性の評価は「A」であったのに対し、実施例 2 及び 3 並びに比較例 1 において、密着性の評価は「X」であった。基材が PET であると、基材がガラスである場合に比べて、その基材上に形成された薄膜と基材との密着性が高くなりやすいことが示唆された。

40